This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年2月20日(20.02.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/014049 A1

(SARUWATARI, Tetsuya) [JP/JP]; 〒745-8691 山口県

徳山市 新宮町1番1号 Yamaguchi (JP). 岩原 昌宏 (IWAHARA, Masahiro) [JP/JP]; 〒745-8691 山口県 徳

(74) 代理人: 片岡 誠 (KATAOKA,Makoto); 〒299-0107 千 葉県 市原市 姉崎海岸 2 4 番地 4 出光興産株式会社

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY,

CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL,

(51) 国際特許分類7:

C07C 37/20, 39/16, B01J 31/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/07924

(22) 国際出願日:

2002年8月2日 (02.08.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): BR, CN, ID, IN, KR, SG, US, ZA.

知的財産センター Chiba (JP).

山市新宮町 1番 1号 Yamaguchi (JP).

(30) 優先権データ:

特願2001-237889 2001年8月6日(06.08.2001)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 出光石油 化学株式会社 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒130-0015 東京都 墨田区 横網一丁目 6番1号 Tokyo (JP).

添付公開書類: 国際調査報告書

PT, SE, SK, TR).

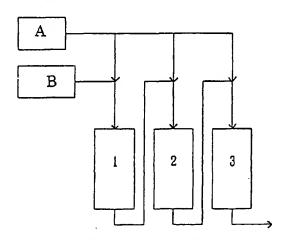
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 猿渡 鉄也

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING BISPHENOL-A

(54) 発明の名称: ビスフェノールAの製造方法



Destract: A method for producing bisphenol-A through the continuous feed of phenol and acetone to a reaction unit having at least two reaction-regions, wherein an acidic cation exchange resin in which 15-to 50% of the acid points in the resin is neutralized with a sulfur-containing nitrogen compound is used as a catalyst, and an acetone having a methanol content of 3.000 ppm or leave dividedly fed to the at least two reaction regions. The method allows the elongation and acetone to a reaction unit having at dividedly fed to the at least two reaction regions. The method allows the elongation and acetone to a reaction unit having at method points in the resin is neutralized.

(57) 要約:

直列に接続された少なくとも二つの反応帯域を有する反応装置にフェノールとアセトンとを連続的に供給してビスフェノールAを製造する方法において、触媒として酸点の15~50%が含硫黄窒素化合物で部分的に中和された酸性陽イオン交換樹脂を用い、かつ、メタノール濃度が3,000ppm以下のアセトンを少なくとも二つの反応帯域に分割して供給するビスフェノールAの製造方法である。触媒として使用する酸性陽イオン交換樹脂の寿命の延長が可能なビスフェノールAの製造方法を提供する。

明細書

ビスフェノールAの製造方法

技術分野

本発明は、触媒として使用する酸性陽イオン交換樹脂の寿命の延長が可能なビスフェノールAの製造方法に関する。ビスフェノールAはポリカーボネート樹脂,エポキシ樹脂,ポリアリレート樹脂等の原料として有用である。

背景技術

ビスフェノールA [2, 2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン]は、ポリカーボネート樹脂やポリアリレート樹脂などのエンジニアリングプラスチック、あるいはエポキシ樹脂などの原料として重要な化合物であることが知られており、近年その需要はますます増大する傾向にある。

このビスフェノールAは、酸性陽イオン交換樹脂触媒及び、必要によりアルキルメルカプタンなどの硫黄化合物の助触媒の存在下、アセトンと過剰のフェノールとを縮合させることにより製造されることは知られている。酸性陽イオン交換樹脂触媒は経時的に劣化する。その主な劣化原因は原料由来の重質物であり、反応器の入り口側から劣化が始まる。その劣化速度は速いため、過剰な触媒を充填し長期の連続運転を行っている。触媒の劣化が始まると、生産量を維持する(フェノール転化率を維持する)ために、反応器に供給するアセトンを経路的に増やす必要がある。その際、反応器出口の未反応アセトンは蒸留塔で回収するため、増加できるアセトン量は蒸留塔の能力により制限される。即ち、蒸留塔の能力に限界がきた時点で新しい触媒に交換するわけである。したがって、反応条件を適正にコントロールしてアセ

製造コストの削減につながる。ところで、目的は異なるが反応条件の改良については、いくつかの公開された特許がある。例えば、特開昭 54-19952号公報、特許第2779952号公報、特開平11-246458号公報、米国特許第4400555号明細書には、反応器を直列に設置し、カルボニル化合物を各反応器に分割添加することが記載されているが、酸性陽イオン交換樹脂の寿命の延長に関しては改良の余地があった。

本発明は、上記観点からなされたもので、触媒として使用する酸性 陽イオン交換樹脂の寿命の延長が可能なビスフェノールAの製造方法 を提供することを目的とするものである。

発明の開示

本発明者らは鋭意研究の結果、直列に接続された少なくとも二つの 反応帯域を有する反応装置にフェノールとアセトンとを連続的に供給 してビスフェノールAを製造する方法において、触媒として特定の部 分的に中和された酸性陽イオン交換樹脂を用い、かつ、メタノール濃 度が特定量のアセトンを少なくとも二つの反応帯域に分割して供給す ることにより高いフェノール転化率を維持できることを見出し、本発 明を完成させたものである。

すなわち、本発明は、直列に接続された少なくとも二つの反応帯域を有する反応装置にフェノールとアセトンとを連続的に供給してビスフェノールAを製造する方法において、触媒として酸点の15~50%が含硫黄窒素化合物で部分的に中和された酸性陽イオン交換樹脂を用い、かつ、メタノール濃度が3,000ppm以下のアセトンを少なくとも二つの反応帯域に分割して供給することを特徴するビスフェノールAの製造方法を提供するものである。

図面の簡単な説明

図1は本発明の方法の反応工程におけるフロー図の一例である。 A はアセトン、Bはフェノール、1は第一反応器、2は第二反応器および3は第三反応器を表す。

発明を実施するための最良の形態

以下に、本発明について詳細に説明する。

先ず、ビスフェノールA製造方法の工程の概要について説明する。

工程(1)(反応工程)

ビスフェノールAは、触媒として酸性陽イオン交換樹脂を、必要により助触媒としてアルキルメルカプタンを使用し、アセトンと過剰のフェノールとを反応させることにより製造される。触媒の酸性陽イオン交換樹脂としては、一般にスルホン酸型陽イオン交換樹脂が好適に用いられ、例えばスルホン化スチレン・ジビニルベンゼンコポリマー、スルホン化架橋スチレンポリマー、フェノールホルムアルデヒドースルホン酸樹脂、ベンゼンホルムアルデヒドースルホン酸樹脂などが挙げられる。これらは単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。

反応混合物中には、ビスフェノールAの他に、未反応フェノール, 未反応アセトン、触媒、副生水、アルキルメルカプタン、及び有機硫 黄化合物、着色物質等の副生物を含んでいる。

工程 (2) (副生水, 未反応原料の回収工程)

次に、工程(1)で得られた反応混合物は、減圧蒸留により、未反応アセトン,副生水及びアルキルメルカプタン等が塔頂より除去され、塔底よりビスフェノールA及びフェノール等を含む液状混合物が得られる。その場合の減圧蒸留の条件は、圧力7~80kPa、温度70~180℃の範囲で実施され、この場合、未反応フェノールが共沸し、

その一部は塔頂より系外へ除かれる。

工程 (3) (ビスフェノールAの濃縮工程)

反応混合物から上記のような物質を除いた塔底液については、フェノールは減圧蒸留により留去され、ビスフェノールAは濃縮される。この濃縮残液が次の晶析原料となる。濃縮条件については特に制限はないが、通常温度100~170℃、圧力5~67kPaの条件で行われる。温度が100℃より低いと高真空が必要となり、170℃より高いと次の晶析工程で余分な除熱が必要となる。また、濃縮残液のビスフェノールAの濃度は20~50質量%、好ましくは20~40質量%の範囲である。この濃度が20質量%未満であるとビスフェノールAの回収率が低く、50質量%を超えると晶析後のスラリーの移送が困難となる。

工程(4)(晶析工程)

工程(3)で得られた濃縮残液は、40~70℃まで冷却され、ビスフェノールAとフェノールとの付加物(以下、フェノールアダクトと略称する)が晶析し、スラリー状になる。冷却は、外部熱交換器や晶析機に加えられる水の蒸発による除熱によって行われる。次に、スラリー状の濃縮残液は、濾過、遠心分離等によりフェノールアダクトと反応副生物を含む晶析母液に分離される。この晶析母液は、直接又は一部反応器へリサイクルしたり、一部又は全部をアルカリ分解しフェノールとイソプロペニルフェノールとして回収する。また、一部又は全部を異性化して晶析原料にリサイクルすることもできる。

工程 (5) (フェノールアダクトの加熱溶融工程)

工程(4)で得られたビスフェノールAとフェノールとの1:1アダクトの結晶は $100\sim160$ で加熱溶融され、液状混合物になる。工程(6)(ビスフェノールAの回収工程)

工程 (5) で得られた液状混合物から、減圧蒸留によってフェノー

WO 03/014049 PCT/JP02/07924

ルを除去し、ビスフェノールAが回収される。減圧蒸留の条件は、圧力1~14kPa、温度150~190℃の範囲である。更に、スチームストリッピングにより残存するフェノールを除去する方法も知られている。

工程 (7) (ビスフェノールAの造粒工程)

工程(6)で得られた溶融状態のビスフェノールAは、スプレードライヤー等の造粒装置により液滴にされ、冷却固化されて製品となる。 液滴は、噴霧、散布等により作られ、窒素や空気等によって冷却される。

次に、本発明の方法について詳細に説明する。

本発明は、工程(1)において、直列に接続された少なくとも二つの反応帯域を有する反応装置にフェノールとアセトンとを連続的に供給してビスフェノールAを製造する方法において、触媒として酸点の15~50%が含硫黄窒素化合物で部分的に中和された酸性陽イオン交換樹脂を用い、かつ、メタノール濃度が3,000ppm以下のアセトンを少なくとも二つの反応帯域に分割して供給することを特徴する。

触媒として、含硫黄窒素化合物で酸点の15~50%が部分的に中和された酸性陽イオン交換樹脂が使用される。中和率が15%未満であると、触媒自体の耐メタノール性が損なわれ、アセトンを分割して供給する効果が薄れる。一方、中和率が50%を超えると、触媒の活性が急激に低下するため好ましくない。好ましくは、20~30%である。

中和に使用する含硫黄窒素化合物として、3-メルカプトメチルピリジン、3-メルカプトエチルピリジン、2-メルカプトエチルピリジン、5-メルカプトエチルピリジン等のピリジンアルカンチオールジン、4-メルカプトエチルピリジン等のピリジンアルカンチオール

類、前記のピリジンアルカンチオール類とアセトン,メチルエチルケトン,メチルイソブチルケトン,アセトフェノン,シクロへキサノン等のケトンから得られるピリジルアルカンチオアセタール類、2ーメルカプトエチルアミン,3ーnープロピルメルカプタン等のアミノアルカンチオール類、チアゾリジン,2ージメチルチアゾリジン,シクロアルキルチアゾリジン等のチアゾリジン類を挙げることができ、なかでも、2,2ージメチルチアゾリジン,2ーメルカプトエチルアミンが好ましい。また、アセトン中のメタノール濃度を3,000ppm以下にすることが必須である。3,000ppmを超えると、メタノールの影響が顕著に表れるため好ましくない。好ましくは、2,000ppm以下である。

反応温度については、60~100℃の範囲が好ましい。温度が60℃未満であると、フェノール相が固化することがあり、また、100℃を超えると、イオン交換樹脂の劣化が大きくなり好ましくない。 さらに好ましくは65~95℃の範囲である。

フェノール/全アセトン(モル比)については、6~13の範囲が 好ましい。6未満であると製品ビスフェノールAの色相が不安定にな る場合があり、また、13を超えると反応速度が遅くなったり、フェ ノールの回収量が多くなり好ましくない。好ましくは8~12の範囲 である。

各反応器におけるアセトンの供給量については、特に限定されないが、第一の反応器でアセトンの30~50%を供給し、第二以降の反応器に残りのアセトンを等分に分割して供給すればよい。3段の反応器を採用する場合のフロー図を図1に示す。

なお、各反応器における液時空間速度 (LHSV) は0.2~30

 $H r^{-1}$ の範囲が好ましく、より好ましくは $0.5 \sim 6 H r^{-1}$ の範囲である。

次に、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例になんら制限されるものではない。

[実施例1]

3塔のステンレスカラムに 2, 2 - ジメチルチアゾリジンで酸点の 20%を中和した酸性陽イオン交換樹脂(三菱化学社製、ダイヤイオン SK104)各69ccを水膨潤して充填し、反応温度 75℃で、フェノールを 277cc/hr、アセトンを各塔入口からそれぞれ 8cc/hr供給した。フェノール/全アセトン(モル比)は10であった。また、使用したアセトン中のメタノール濃度は1,000ppmであった。反応開始初期の 3 塔目出口のフェノール転化率は14.0%、500時間経過後は12.8%であった。

[比較例1]

実施例1において、アセトンを一括して1塔目から24cc/hr 供給したこと以外は同様な方法で反応を行った。反応開始初期の3塔 目出口のフェノール転化率は14.0%、500時間経過後は12. 0%であった。これは、実施例1の12.8%に比べて十分に有意差 があるものである。

[比較例2]

実施例1において、触媒としてイオン交換樹脂の中和率10%のものを使用したこと以外は同様な方法で反応を行った。反応開始初期の3塔目出口のフェノール転化率は14.0%、500時間経過後は11.2%であった。

〔比較例3〕

実施例1において、アセトンとしてメタノール濃度5,000pp

mのものを使用したこと以外は同様な方法で反応を行った。反応開始初期の3塔目出口のフェノール転化率は14.0%、500時間経過後は11.8%であった。

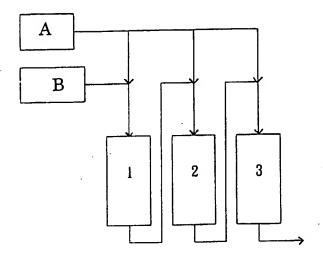
産業上の利用可能性

本発明によれば、直列に接続された少なくとも二つの反応帯域を有する反応装置にフェノールとアセトンとを連続的に供給してビスフェノールAを製造する方法において、触媒として酸点の15~50%が含硫黄窒素化合物で部分的に中和された酸性陽イオン交換樹脂を用い、かつ、メタノール濃度が3,000ppm以下のアセトンを少なくとも二つの反応帯域に分割して供給することにより、触媒として使用する酸性陽イオン交換樹脂の寿命の延長が可能なビスフェノールAの製造方法を提供することができる。

請求の範囲

- 1. 直列に接続された少なくとも二つの反応帯域を有する反応装置にフェノールとアセトンとを連続的に供給してピスフェノールAを製造する方法において、触媒として酸点の15~50%が含硫黄窒素化合物で部分的に中和された酸性陽イオン交換樹脂を用い、かつ、メタノール濃度が3,000ppm以下のアセトンを少なくとも二つの反応帯域に分割して供給することを特徴とするビスフェノールAの製造方法。
- フェノール/全アセトン(モル比)が6~13である請求項
 1記載のビスフェノールAの製造方法。
- 3. 含硫黄窒素化合物がピリジンアルカンチオール類、ピリジルアルカンチオアセタール類、アミノアルカンチオール類およびチアゾリジン類から選ばれる少なくとも1種である請求項1記載のビスフェノールAの製造方法。
- 4. 反応温度が60~100℃の範囲である請求項1記載のビスフェノールAの製造方法。
- 5. 第一の反応帯域に全体の供給アセトンの30~50%を供給する請求項1記載のビスフェノールAの製造方法。
- 6. 各反応帯域における液時空間速度(LHSV)が 0. 2~3 0 Hr⁻¹の範囲である請求項1記載のビスフェノールAの製造方法。

図 1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/07924

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07C37/20, C07C39/16, B01J31/02						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	S SEARCHED					
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 C07C37/20, C07C39/16, B01J	by classification symbols) (31/02				
	tion searched other than minimum documentation to the					
Electronic d	lata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	ren terms usea)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	US 4308404 A (Shell Oil Co.) 29 December, 1981 (29.12.81), & JP 54-19951 A & GB & FR 2397383 A1 & DE & NL 7807405 A		1-6			
A	JP 8-40961 A (Nippon Steel C 13 February, 1996 (13.02.96), (Family: none)	JP 8-40961 A (Nippon Steel Chemical Co., Ltd.), 1-6 13 February, 1996 (13.02.96), (Family: none)				
A	JP 11-246458 A (Mitsubishi C 14 September, 1999 (14.09.99) (Family: none)		1-6			
A	JP 6-92889 A (Idemitsu Petro 05 April, 1994 (05.04.94), (Family: none)	chemical Co., Ltd.),	1-6			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
"A" docum conside "E" earlier date "L" docum cited to special "O" docum means "P" docum than th	A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E" earlier document but published on or after the international filing date date L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
21 October, 2002 (21.10.02) 12 November, 2002 (12.11.02)						
	Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer					
Japanese Patent Office		Authorized Office)				
Forsimile No.		Telephone No.				

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))					
Int. Cl' C07C37/20, C07C39/16, B01J31/02					
B. 調査を行った分野					
調査を行った。	と と小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int. C	1' C07C37/20, C07C39/16,	B01J31/02			
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの				
		•			
	•	_			
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)			
C. 関連する	3と認められる文献		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
·A	US 4308404 A (Shell Oil	Company)	1 — 6		
	1981. 12. 29 & JP 54	-19951 A			
	& GB 1578225 A & FR	2397383 A1	,		
	& DE 2830174 A1 & N	L 7807405 A			
A	│ │JP 8-40961 A(新日鐵化等	学株式会社)	1-6		
A	1996.02.13 (ファミリーな		_		
		•			
A	JP 11-246458 A (三菱/		1-6		
	1999.09.14 (ファミリーカ	なし)			
区 で に で に で に で に で に で に で に で に で に で	とにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献の		の日の後に公表された文献 「丁」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって		
もの	A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論				
	「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの				
	以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの				
日若し	日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以				
	型由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当菜者にとって! よって進歩性がないと考えられる			
	質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	- 		
国際調本を含	国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 1 2 1 1 00				
四际砜笙で元	21. 10. 02	12.	11.02		
	国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 H 9 3 5 7				
郵便番号100-8915					
	東京都千代田区殿が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3443				

国際調査報告

引用文献名 及び一部の箇所が開連するときは、その関連する箇所の表示	<u>(続き).</u> 用文献の	民任力と		
1994.04.05 (ファミリーなし)	テゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
	Α	JP 6-92889 A (出光石油化学株式会社)	1-6	
		1994. U4. U5 (ノアミリーない) 		
		, w		
		·		
		·		